

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 4 月 7 日 (2005.4.7)

【公開番号】特開 2003-207885 (P2003-207885A)

【公開日】平成 15 年 7 月 25 日 (2003.7.25)

【出願番号】特願 2002-3899 (P2002-3899)

【国際特許分類第 7 版】

G 0 3 F 7/004

C 0 7 C 25/02

C 0 7 C 381/12

G 0 3 F 7/039

H 0 1 L 21/027

【F I】

G 0 3 F 7/004 5 0 3 A

G 0 3 F 7/004 5 0 1

C 0 7 C 25/02

C 0 7 C 381/12

G 0 3 F 7/039 6 0 1

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 5 月 27 日 (2004.5.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(A) 活性光線又は放射線の照射により、少なくとも 1 つのフッ素原子及び / 又は少なくとも 1 つのフッ素原子を有する基で置換された芳香族スルホン酸を発生する化合物少なくとも 1 種、

(B) 単環又は多環の脂環炭化水素構造を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液中での溶解度が増大する樹脂

(C) 少なくとも 3 つ以上の水酸基又は置換された水酸基を有し、かつ少なくとも一つの環状構造を有する化合物

を含有することを特徴とするポジ型感光性組成物。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のポジ型感光性組成物により膜を形成し、当該膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。